

ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОПРОВОДИМОСТЬ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КВАНТОВЫХ ЯМ В МНОГОСЛОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ CaAs/AlGaAs

В. А. Горбылев, И. Д. Залевский, А. И. Петров, А. А. Чельный,
Г. Х. Аветисян, В. Б. Куликов,* В. М. Чукичев,** А. Э. Юнович **

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119899, Москва, Россия

* Научно-производственное объединение «Пульсар», 105187, Москва, Россия

** Акционерное общество «Сигма-Плюс», 118133, Москва, Россия

(Получена 7 декабря 1992 г. Принята к печати 26 января 1993 г.)

Спектры фотопроводимости, обусловленной оптическими переходами из локализованных состояний в квантовых ямах GaAs/AlGaAs в состояния в континууме, сопоставлены со спектрами катодолюминесценции. Структуры были изготовлены методом МОС гидридной эпитаксии с толщинами слоев GaAs 3÷6, Al_xGa_{1-x}As ($x = 0.28 \pm 0.35$) 30 ÷ 50 нм и числом периодов до 70. Спектры фотопроводимости с максимумом в области длин волн 8÷10 мкм имеют особенности, которые можно объяснить, считая существенным возбуждение электронов как с первых уровней размерного квантования в ямах, так и с уровней доноров или хвостов плотности состояний в этих ямах. Основные максимумы в спектрах люминесценции структур соответствуют излучательной рекомбинации электронов на донорах с дырками в квантовых ямах. Энергия активации темнового тока фотоприемников при малых напряжениях и температурах 40÷90 К соответствовала порогу фотовозбуждения и была ~0.12 эВ.¹ Чувствительность фотоприемников с меза-структурой диаметром 200 мкм составляла 0.8 А/Вт.

1. Введение

После первых идей [1] об инфракрасной (ИК) фотопроводимости (ФП), обусловленной возбуждением электронов из локализованных состояний в квантовых ямах на состояния в континууме над барьерами, работы группы Левина и др. [2-6] о свойствах множественных квантовых ям (МКЯ) в гетероструктурах GaAs/AlGaAs показали, что на основе таких структур возможно и перспективно создание чувствительных фотоприемников на область длин волн 8÷14 мкм.

Теоретические работы о фотопроводимости таких структур рассматривали главным образом оптические переходы из основных состояний двумерного газа в ямах (см. [2-6]), а также статьи Шика, Осипова и др. [7-9]. В работе Кастальского и др. [10] обращалось внимание на возможность участия в ФП переходов электронов из связанных состояний на донорах в квантовых ямах. В ней были сопоставлены спектры ФП и фотoluminesценции МКЯ с целью расшифровки роли разных оптических переходов.

В цитированных статьях структуры были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Недавно появилось сообщение о такого рода структурах, выращенных методом газовой эпитаксии из металлоорганических соединений (MOC) [11, 12].

¹ Работа частично доложена на Международной конференции по физике полупроводников с узкой запрещенной зоной, Англия, Саутхэмптон, июль 1992 г., будет опубликована в журнале «Semiconductor Science and Technology».

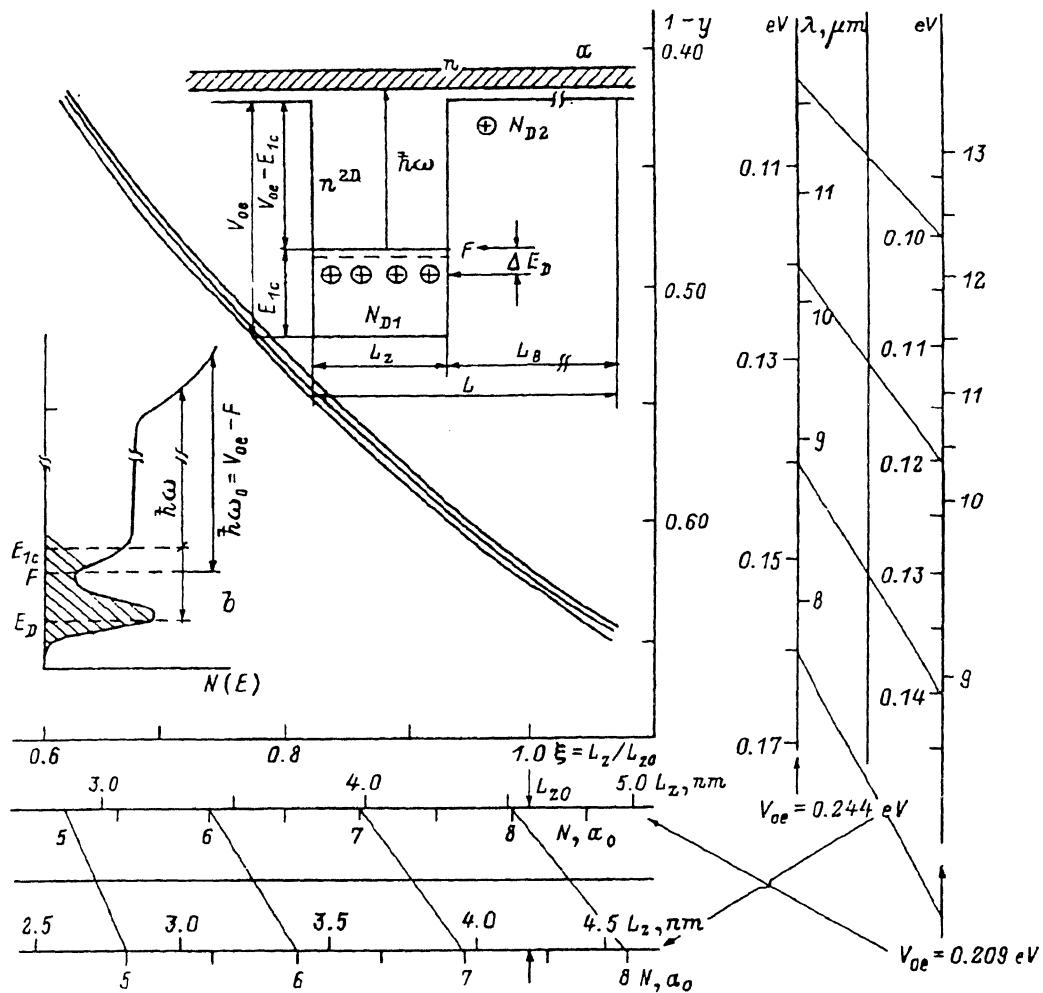


Рис. 1. Зависимость энергии основного состояния в квантовых ямах от ширины ям в отн. ед. уравнение (9). Размерные шкалы справа для величины $V_{oe} - E_{1c}$ и внизу для ширины L_z даны для указанных значений V_{oe} ; a — энергетическая диаграмма структуры с указанием зарядов электронов и доноров; b — схема плотности состояний с «хвостами», обусловленными флуктуациями.

В настоящей работе были исследованы структуры с МКЯ GaAs/AlGaAs, выращенные методом МОС гидридной эпитаксии. Особый интерес представляло выяснение роли доноров в ИК фотопроводимости и влияние флуктуаций потенциала на спектры ФП и люминесценции. Были сопоставлены спектры ИК-ФП, спектры катодолюминесценции (КЛ) и температурные зависимости темнового тока.

2. Теоретическая модель

2.1. Теоретические работы Шика [7–13], Осипова, Шадрина и др. [8, 9], работы [2–6] довольно подробно рассматривали ФП, которая определяется возбуждением электронов из состояний на первых уровнях размерного квантования в ямах в состояния континуума над барьером. Рассмотрим возможную роль

переходов из состояний на донорах, локализованных в ямах, в континуум (рис. 1, а).

Для увеличения вероятности оптического перехода из первого уровня в континуум второй уровень (мини-зона) должен быть «вытолкнут» в состояния над барьером. Для этого ширина ямы L_z должна удовлетворять условию

$$I_z < I_{z0} = \pi \hbar / (2m^* V_0)^{-1/2} = 0.613 ((m^*/m_0) V_0)^{-1/2}. \quad (1)$$

Для гетероструктур GaAs/Al_xGa_{1-x}As при $x = 0.26 \div 0.34$ энергетический барьер в зоне проводимости $V_0 = V_{0c}$ изменяется в пределах $V_{0c} = 0.18 \div 0.26$ эВ, эффективные массы электронов m_c^* с учетом непарараболичности в упрощенном двухзонном приближении имеют значения $m^* = m_c^* = m_{co}^* (1 + 2V_{0c}/E_{g1}) = (0.083 \div 0.089)m_0^*$. При таких значениях величина $L_{z0} = 5 \div 4$ нм, т. е. меньше радиуса водородоподобного донора в объеме, $a_D^{3D} \gg L_{z0}$ (для GaAs $a_D^{3D} = 12$ нм, энергия ионизации доноров $E_D^{3D} = 5.8$ мэВ).

В таком случае энергии ионизации, как было показано Бастардом [14] и др. [15, 16], существенно увеличиваются и зависят от положения доноров относительно границ ямы $\Delta E_D = 3 \div 4 E_D^{3D}$. Для GaAs $\Delta E_D = 17 \div 23$ мэВ, что существенно превышает kT при $T \leq 80$ К. Величина ΔE_D становится порядка $0.15 \div 0.20$ от V_{0c} .

2.2. При таких условиях часть доноров должна быть заполнена электронами. Для вычисления уровня Ферми в структуре с МКЯ следует учесть заряды электронов над барьерами с концентрацией n , заряды электронов в двумерном газе с концентрацией n^{2D} , заряды доноров в ямах N_{D1}^+ и в барьерах N_{D2}^+ (рис. 1, а). Ширина барьера $L_B \gg L_{z0}$ в соответствии с требованиями малости туннельных токов [2-6]. Поэтому даже при $N_{D2} \ll N_{D1}$ при расчете на период $L = L_z + L_B$ надо учитывать N_{D2}

$$nL + n^{2D} = N_{D1}^+ L_z + N_{D2}^+ L_B. \quad (2)$$

Здесь

$$n = N_{c2}^* \exp(-(V_{0c} - F)/kT), \quad (3)$$

$$n^{2D} = N_{c1}^{2D} \ln(1 + \exp((F - E_{1c})/kT)), \quad (4)$$

$$N_{D1}^+ = N_{D1} (1 - f_{D1}) = N_{D1} (1 + 2 \exp((F - E_{D1})/kT))^{-1}, \quad N_{D2}^+ \equiv N_{D2}. \quad (5)$$

Эффективная плотность состояний над барьером N_{c2}^* , хотя и искажена второй зоной размерного квантования, в силу неравенства $L_B \gg L_z$ может быть принята, равной

$$N_{c2}^* \equiv N_{c2} = (1/4)(2m_{c2}^* kT/\pi\hbar)^{3/2} \quad (6)$$

В двумерной плотности состояний следует учесть непарараболичность

$$N_{c1}^{2D} = (m_{c1}^* kT/\pi\hbar^2), \quad m_{c1}^* = m_{c0}^* (1 + 2(E_{1c} + kT)/E_{g1}). \quad (7)$$

2.3. Первый уровень размерного квантования E_{c1} в силу большой величины L_B можно рассчитать из известного уравнения (см. [16, 17])

$$E_g (k_1 L_1 / 2) = (m_1^* (V_0 - E) / m_2^* E)^{1/2}, \quad k_1 = (2 m_1^* E)^{1/2} \hbar. \quad (8)$$

В безразмерном виде, где $\xi = L_z / L_{z0}$, $y = E_1 / V_0$, запишем

$$\xi = \frac{2 (1 + 2/y_g)^{1/2} \operatorname{arctg} \{ b (1 + 2y/y_g)^{1/2} ((1 - y)/y)^{1/2} \}}{y^{1/2} (1 + 2y/y_g)^{1/2}}, \quad y_g = E_{g1} / V_0. \quad (9)$$

Ширина запрещенной зоны GaAs при $T = 4.2 \div 80$ К равна $E_{g1} = 1.518 \div 1.511$ эВ, так что член, учитывающий непараболичность, имеет величину $2/y_g = 0.25 \div 0.29$. Величина

$$b = (m_1^*/m_2^*)^{1/2} \quad (10)$$

изменяется в пределах $b = 0.90 \div 0.88$.

Для этих величин решение уравнения (9) показано на рис. 1, на дополнительных шкалах которого указаны размерные значения ширины ям L_z и энергий $V_{0e} - E_{1c}$ при значениях V_{0e} в пределах $V_{0e} = 0.20 \div 0.25$ эВ. Видно, что решения мало зависят от поправок на величины Y_g и E_{g1} . Однако выбор параметра V_{0e} является критическим для расчетов в размерных единицах. Из дополнительных шкал видно, что для диапазона длин волн $8 \div 10$ мкм ширина ям выбирается в сравнительно узких пределах, $6 \div 8$ постоянных решетки, т. е. $12 \div 16$ атомных слоев. Дополнительные шкалы могут служить номограммами.

2.4. Поскольку известны значения E_{1c} , а величины ΔE_D «привязаны» к ним [15], можно решать уравнение (2) относительно F . При достаточно больших значениях $V_{0e} - F$ зарядом электронов над барьером можно пренебречь, $nL \ll n^{2D}$. Представим (2), взяв за меру энергий kT , а за меру концентраций $-N_{c1}^{2D}$

$$\varphi = (F - E_{c1})/(kT), \quad \varepsilon_D = (E_{c1} - E_D)/(kT) = \Delta E_D/(kT), \quad A = N_{D1} L_z / N_{c1}^{2D}, \\ B = N_{D2} L_B / N_{c1}^{2D}. \quad (11)$$

$$\ln(1 + \exp \varphi) = A (1 + 2 \exp(\varphi + \varepsilon_D))^{-1} + B.$$

Оно решалось относительно φ при $N_{D1} = (0.5 \div 2) \cdot 10^{18}$ см⁻³, $L_z = 3 \div 5$ нм, $L_B = 30 \div 50$ нм, $N^{2D} = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻³, $T = 77$ К, $\varepsilon_D = 2.6 \div 3.5$. Так, при $A = 1 \div 4$, $B = 0.3$, значения $\varphi = -0.9 \div -0.4$, т. е. уровень Ферми лежит ниже E_{1c} в пределах kT . Это понятный результат для некомпенсированного полупроводника n -типа при низких T . Величина φ чувствительна к концентрации N_{D2} из-за неравенства $L_B \gg L_z$, увеличение параметра B от 0.3 до 0.6 сдвигает F вверх на kT , т. е. двумерный электронный газ может стать вырожденным.

Этот результат требует уточнения теоретических расчетов характеристик ИК-ФП, поскольку ранее оценки предполагали вырождение, $F - E_{1c} = 3 \div 5kT$. Однако формула (3) для расчета равновесных n останется неизменной, а изменится лишь $V_{0e} - F$. Порог фотовозбуждения, как и в прежних моделях, близок к величине $V_{0e} - E_{1c}$, но может зависеть от F

$$\hbar\omega_0 = V_{0e} - F. \quad (12)$$

Для переходов электронов с доноров энергия фотона больше

$$\hbar\omega_{D1 - c2} = V_{0e} - E_{1c} + \Delta_D. \quad (13)$$

Должны изменяться и вероятности оптического поглощения, могут быть смягчены правила отбора по поляризации.

2.5. Остановимся на вопросе о флюктуациях потенциала, который возникает в связи с ролью доноров. Из спектров люминесценции [15] следует, что за счет случайных флюктуаций ширины ям порядка атомного слоя $a_0/2$, на обеих гетерограницах гетероструктуры разброс энергий $\delta(E_{lc})$ определяется величиной

$$\delta E_{lc} = \pm (\partial E_{lc}/\partial L_z)(a_0/2), \quad \partial E_{lc}/\partial L_z = (\partial y/\partial \xi) V_{oe}/L_z. \quad (14)$$

Из рис. 1 следует, что $\partial y/\partial \xi = -0.7 \div -0.4$, $\partial E_{lc}/\partial L_z = \pm 9 \div 5$ мэВ.

Другой причиной флюктуаций является зависимость E_D от положения в яме. В двумерном случае $\delta(\Delta E_D) = 5.8$ мэВ. Третьей причиной флюктуаций могут быть кулоновские поля доноров при больших концентрациях (работы Эфроса и др. [18, 19]). Для двумерных структур других типов $\delta E \ll 0.1 (e^2 N_s^{1/2}/\epsilon)$, в нашем случае поверхностные концентрации $N_s = N_{D1}L_z + N_{D2}L_B = (0.25 \div 1) \cdot 10^{12}$ см⁻² и $\delta E = 6 \div 12$ мэВ.

Приведенные оценки показывают, что влияние всех этих флюктуаций для спектров фотопроводимости должно быть не менее существенно, чем непрерывность энергетического спектра в зоне над барьерами. Встает вопрос, насколько правомерно предыдущее рассмотрение положения уровня F в условиях флюктуаций, так как локальные уровни доноров будут размываться в примесную зону и образовывать «хвост» плотности состояний. В отличие от трехмерного случая наши оценки дают $N_{D1} = N_{c1}^{2D}$ и $\delta E \ll \Delta E_D$ при $N_{D1} = 5 \cdot 10^{17}$ см⁻³. Поэтому приближенно оценки F остаются справедливыми, хотя параметр ΔE_D имеет разброс. На рис. 1, b дана схема плотности состояний в спектре с учетом его размытия вследствие флюктуаций.

3. Изготовление структур

Структуры были выращены методом МОС гидридной эпитаксии на установке с горизонтальным трубчатым реактором при давлении 65 мм рт. ст. и температуре 700 °С. Технология позволяла создавать гетерограницы с шероховатостью порядка одного-двух атомных слоев и числом периодов до 70.

Характерные параметры были следующими. На подложках GaAs *n*-типа, ориентированных в плоскости (100), выращивался буферный слой GaAs : Si с концентрацией доноров $N_D = 2 \cdot 10^{18}$ см⁻³ и толщиной 0.1 мкм. Затем 70 периодов сверхрешетки с ямами из GaAs толщиной $L_z = 4.0$ нм и концентрацией $N_D = 5 \cdot 10^{17}$ см⁻³ и барьерами из Al_xGa_{1-x}As ($x = 0.29 \pm 0.01$) толщиной $L_B = 31.0$ нм и концентрацией $N_{D2} = 2 \cdot 10^{16}$ см⁻³. В последующих опытах варьировались толщины ям $L_z = 3 \div 6$ нм, $L_B = 30 \div 50$ нм, состав $x = 0.28 \div 0.35$, концентрация $N_{D1} = 5 \cdot 10^{17} \div 2 \cdot 10^{18}$ см⁻³.

Затем образцы ФП изготавливались в виде меза-структур диаметром 200 мкм и контактами из Al.

4. Результаты экспериментов и их обсуждение

4.1. На рис. 2 показаны спектры ФП при двух температурах: $T = 40$ и $T = 80$ К. При $T = 40$ К они были измерены с помощью интерференционных фильтров с шириной $\Delta\lambda \approx 0.1$ мкм при 80 К на спектрометре ИКС-21 с призмой NaCl. Спектры имеют вид полосы с максимумом вблизи 9.6 мкм. Прямое сравнение спектров требует дополнительных измерений при разных поляризациях возбуждающего света (направление пучка в опытах *a* и *b* было либо параллельно поверхности структуры, либо под углом сверху или со стороны подложки). Однако различие в уширении спектра при 40 К со стороны высоких энергий не

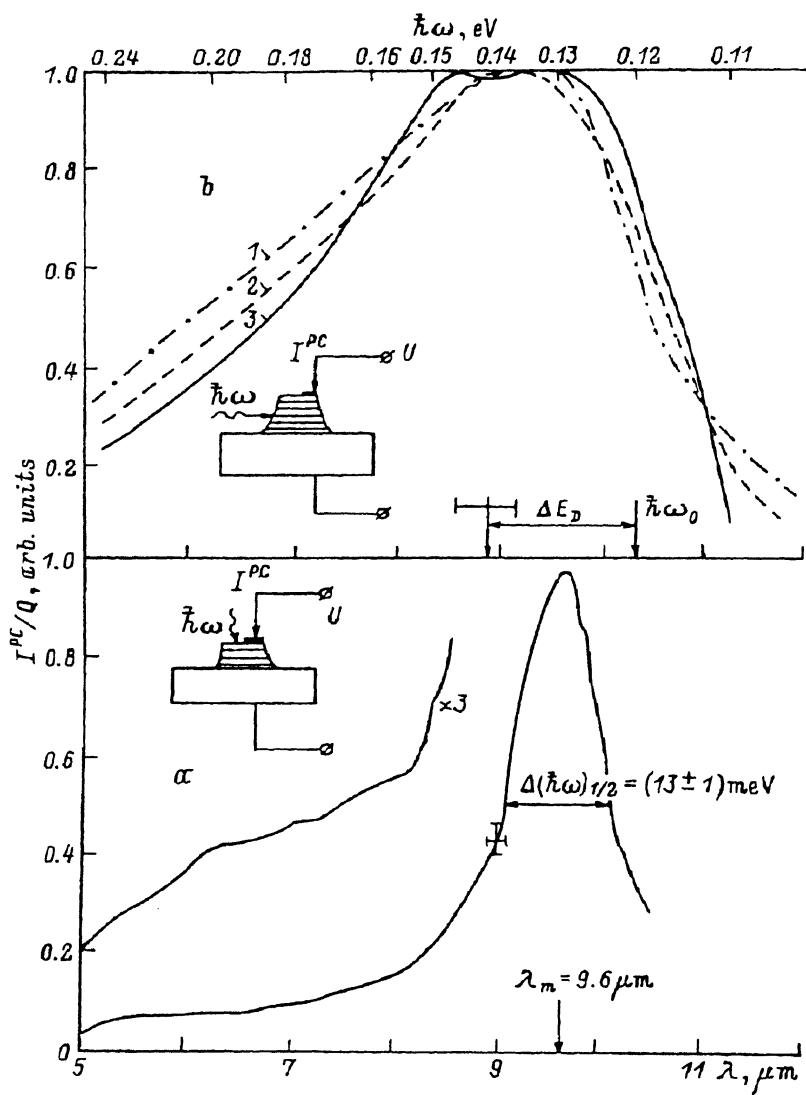


Рис. 2. Спектры фотопроводимости фотоприемника с МКЯ GaAs/AlGaAs: *a* — измеренные при $T = 80$ К на спектрометре ИКС-21; *b* — измеренные при $T = 40$ К с помощью интерференционных фильтров. На вставках — геометрия возбуждения. Стрелками показаны порог фотовозбуждения и энергия фотоионизации доноров. *a*) $U = 0.8$ В; *b*) U , В: 1 — 0.2, 2 — 0.5, 3 — 4.0; I^{PC}_{max} , нА: 1 — 2, 3 — 6, 3 — 5.

подлежит сомнению. В этой же области энергий при 80 К имеется хвост, на котором можно различить некоторую структуру. При 80 К ширина спектра на половине интенсивности $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} = 13$ мэВ. При малых полях при $T = 40$ К можно различить двугорбую структуру в спектре. При увеличении напряжения на гетероструктуре при обеих температурах спектр уширялся и затягивался в обе стороны. Это показано на рис. 2, *b* для $U = 0.2 \div 1.0$ В.

4.2. На рис. 2 стрелкой показано значение порога фотоионизации вблизи $\lambda_0 = 10.4 \pm 0.1$ мкм ($\hbar\omega = 0.118 \pm 0.002$ эВ), которое будет обсуждаться в связи с результатами по люминесценции. Там же показано стрелкой отстоящее от него на величину ΔE_D значение энергии, соответствующей формуле (13) с

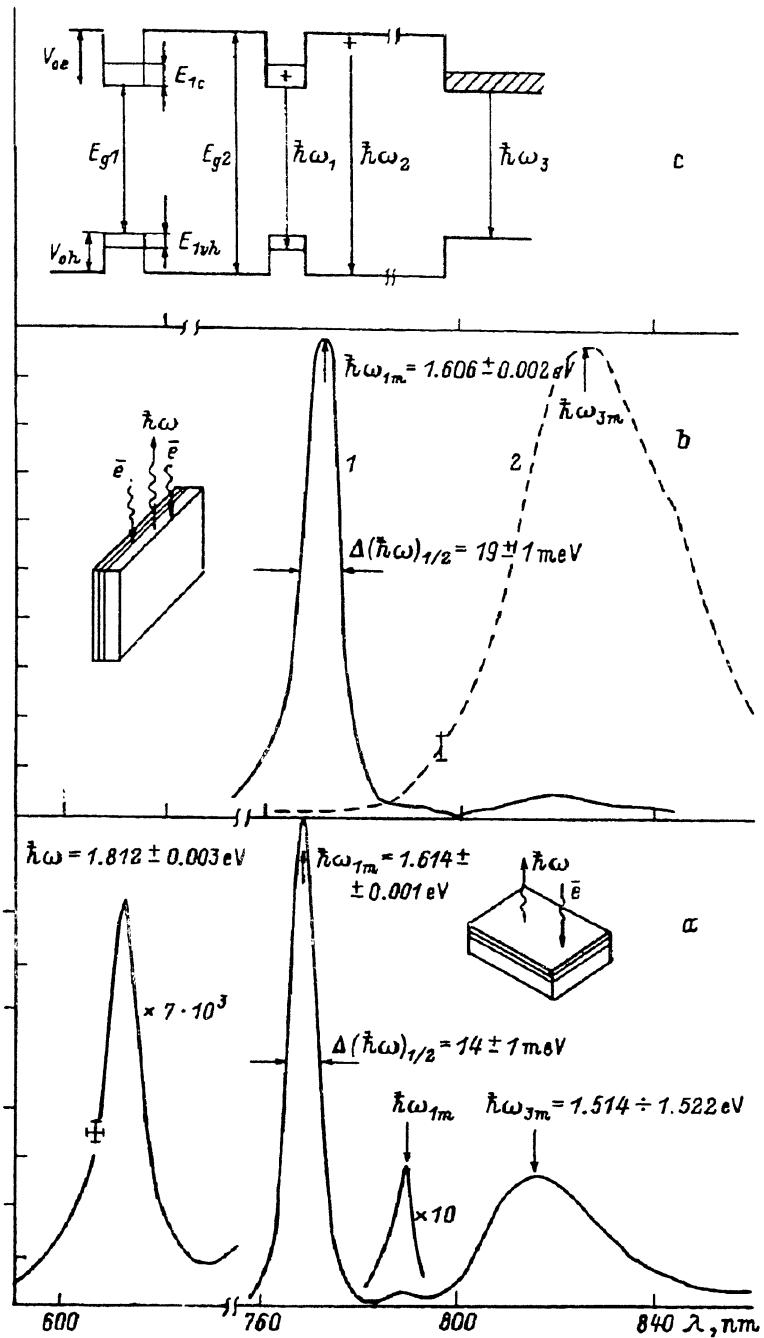


Рис. 3. Спектры катодолюминесценции структуры с МКЯ GaAs/AlGaAs: *a* — измеренные при $T = 4.5 \text{ K}$ при возбуждении мощным электронным пучком $E = 50 \text{ кэВ}$, $j = 0.05 \text{ мкА}$; *b* — измеренные при $T = 80 \text{ K}$ в РЭМ. $E = 30 \text{ кэВ}$, $j = 20 \text{ нА}$. На вставках — геометрия возбуждения; *c* — диаграмма электронных и излучательных переходов в структуре GaAs/Al_xGa_{1-x}As ($x = 0.29 \pm 0.01$), $L_z = 40$, $L_B = 31 \text{ нм}$, $T = 70 \text{ K}$.

указанием разброса $\sigma(E_D)$. Наблюдаемые изменения в спектре качественно объясняются, если при повышении T часть электронов с доноров или из хвоста плотности состояний будет ионизована на состояния в двумерном газе $E > E_{1c}$, как это обсуждалось в модели.

4.3. На рис. 3 показаны спектры КЛ образца из той же структуры. На рис. 3, *a* спектр был снят при $T = 4.5$ К на электронной пушке со сравнительно большой мощностью в пучке. Облучение электронным пучком с энергией $E = 50$ кэВ обеспечивало возбуждение МКЯ сквозь контактный слой на всю толщину структуры.

Основной пик в спектре имеет энергию в максимуме $\hbar\omega_{1m} = 1.614 \pm 0.001$ эВ и ширину $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} = 14 \pm 1$ мэВ. Со стороны высоких энергий в спектрах удалось обнаружить (при увеличении тока в пучке до 1 мкА, увеличении ширины щели спектрометра и коэффициента усиления сигналов) слабую линию с максимумом $\hbar\omega_{2m} = 1.842 \pm 0.003$ эВ. В области малых энергий наблюдалась широкая полоса с максимумом, который изменялся в пределах $\hbar\omega_{3m} = 1.514 \div 1.522$ эВ, более длинноволновое значение наблюдалось при возбуждении образца со стороны подложки, когда не наблюдались линии $\hbar\omega_1$ и $\hbar\omega_2$. В спектрах можно было различить слабый максимум вблизи $\hbar\omega_{4m} = 1.574$ эВ.

4.4. Для уточнения локального происхождения разных полос в спектрах были исследованы спектры КЛ в растровом электронном микроскопе (РЭМ) (см. методику в [20]) при наблюдении со стороны скола структуры (рис. 3, *b*). Основной максимум при $T = 80$ К имел энергию $\hbar\omega_{1m} = 1.606 \pm 0.002$ эВ, он наблюдался, когда электронный пучок был сфокусирован в растр размером 5×3 мкм на поверхности гетероструктуры. При таком возбуждении полоса в длинноволновой области была на порядок менее интенсивной, чем основная. При фокусировке растра на поверхность подложки в спектре оставалась только полоса $\hbar\omega_3$, максимум которой был сдвинут в длинноволновую сторону (спектр 2 на рис. 3, *b*).

Спектры КЛ, которые были сняты после стравливания контактного слоя с поверхности структуры, обнаруживали смещение максимумов $\hbar\omega_{1m}$ и $\hbar\omega_{2m}$ на $2 \div 4$ мэВ вверх по энергии и относительное увеличение интенсивности пика $\hbar\omega_2$. Это свидетельствовало о частичном самопоглощении в контактном слое GaAs.

4.5. В легированных донорами квантовых ямах GaAs/AlGaAs излучательная рекомбинация происходит, согласно [21], за счет рекомбинации электронов на донорах с тяжелыми дырками. Хотя в наших структурах концентрация доноров более чем на порядок больше, чем в [21], примем в силу оценок величины флуктуаций эту модель для полосы $\hbar\omega_1$ (рис. 3, *a*)

$$\hbar\omega_{1m} = E_{g1} + \Delta_{1c} + \Delta E_{1vh} - \Delta E_D. \quad (15)$$

Из оценок ΔE_D и указанных погрешностей следует, что сумма $\Delta E_{1c} + \Delta E_{1vh} = 0.118 \pm 0.009$ эВ.

Полоса $\hbar\omega_2$ происходит и за счет рекомбинации электронов на донорах с дырками в барьерах (см. [17]).

$$\hbar\omega_{2m} = E_{g2} - \Delta E_{D2}. \quad (16)$$

С такой интерпретацией согласуется отношение интенсивностей $I_2/I_1 \equiv 10^{-4}$, т. е. того же порядка, что и теоретические оценки отношения времени релаксации горячих электронов к излучательному времени жизни [2-12].

Если принять $V_{0e} = 0.60(E_{g2} - E_{g1})$ и значение $\Delta E_{D2} = 0.010 \pm 0.002$ эВ, то из данных по КЛ получим $V_{0e} = 0.200 \pm 0.011$ эВ. Эта величина меньше, чем рассчитанное из формул для $E_{g2}(x)$ значение при $x = 0.29$. Приведенное на рис. 1 значение $V_{0e} = 0.209$ мэВ соответствует $x = 0.26$.

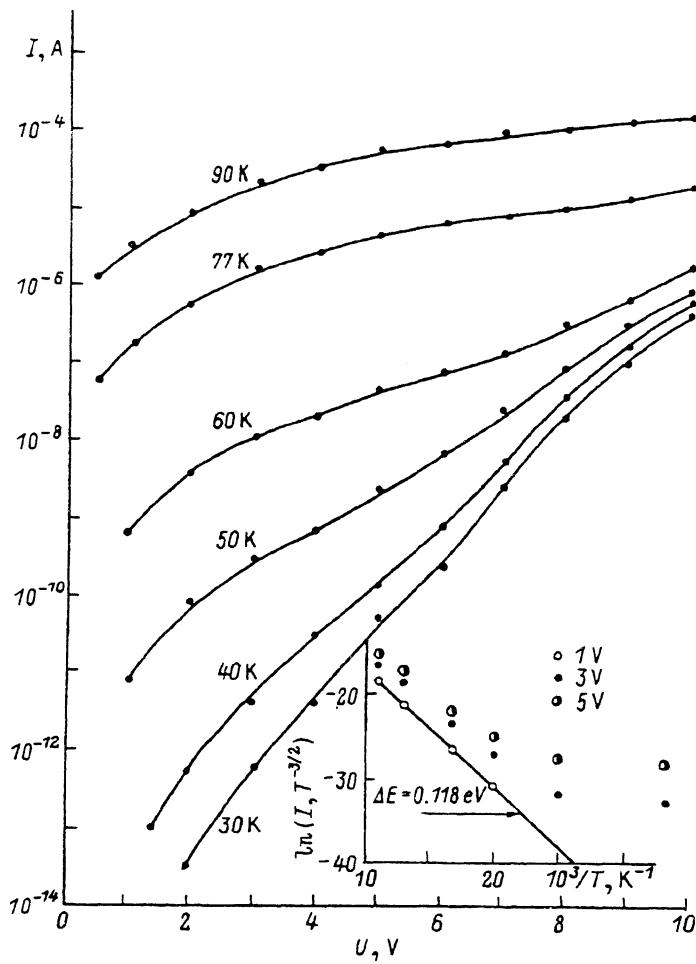


Рис. 4. Вольт-амперные характеристики ИК фотоприемника с МКЯ из GaAs/AlGaAs при различных температурах; диаметр мезаструктуры 200 мкм. На вставке — зависимость величины $\ln(I, T^{-3/2})$ при различных напряжениях.

Решение уравнения (8) при $V_{0c} = 0.200$ эВ и $L_{z0} = 4.7$ нм. (рис. 1) дает значение $\Delta E_{1c} = 0.086$ эВ. При этих значениях параметров решение (8) для дырок дает $\Delta E_{1b} = 0.027$ эВ, что согласуется с формулой (15) в пределах погрешностей эксперимента и задания параметров.

4.6. Сопоставим полученное значение $V_{0c} - E_{1c} = 0.114$ эВ с результатом для порога фотовозбуждения из спектров ФП; $\hbar\omega_0 = 0.118$ эВ. Оно согласуется с оценками смещения порога в соответствии с положением уровня Ферми (12), хотя находится в пределах погрешностей расчетов и эксперимента.

4.7. На рис. 4 показаны темновые вольт-амперные характеристики фотоприемника при изменении T . При малых напряжениях U ток изменяется более чем на 9 порядков; при 77 К и $U = 0.5$ В $I = 4 \div 6 \cdot 10^{-8}$ А. На вставке к рис. 4 проведено сопоставление характеристики с зависимостью равновесной концентрации от T , следующей из формул (3) и (12), поскольку $I \sim n$. При малых напряжениях ($U = 1$ В) и более высоких температурах ($T = 50$ К) зависимость величины $IT^{-3/2}$ имеет энергию активации $\Delta E = 0.118 \div 0.008$ эВ. Это хорошо согласуется с данными по ФП и интерпретацией данных по КЛ.

При больших напряжениях и меньших T точки в координатах Аррениуса сильно отклоняются от прямых, наклон характеристик на рис. 4 существенно отличается от kT/e . В этой области U и T преобладает туннельный механизм активации электронов, кроме того, в области сильных полей необходимо рассматривать насыщение скорости горячих электронов. В работах [2–6] проводился анализ темновых характеристик с учетом этих эффектов, в настоящей статье мы не рассматриваем эту проблему.

4.8. Приведем результаты измерений фоточувствительности ФП с МКЯ, которые были сделаны без специальных устройств для ввода излучения с определенной поляризацией, с использованием имитатора излучения абсолютно черного тела. При $T = 77$ К и $U = 2$ В величина чувствительности была $S = 0.8$ А/Вт.

5. Выводы

1. Методами МОС гидридной эпитаксии гетероструктур GaAs/Al_xGa_{1-x}As созданы структуры с множественными квантовыми ямами шириной $4 \div 6$ нм и числом периодов до 70 для инфракрасных фотоприемников в диапазоне длин волн $8 \div 10$ мкм.

2. Показано, что в ИК фотопроводимости, обусловленной возбуждением электронов из локализованных состояний в ямах на состояния в континууме, существенную роль играют доноры в квантовых ямах.

3. Сопоставление спектров катодолюминесценции со спектрами ИК фотопроводимости дает хорошо согласующиеся результаты об энергетической структуре в модели прямоугольных квантовых ям.

4. Спектры фотопроводимости и катодолюминесценции существенно зависят от флуктуаций потенциала, обусловленных шероховатостью границ порядка одного атомного слоя, случайным расположением доноров от гетерограниц, кулоновскими полями доноров при больших концентрациях.

5. Темновые токи и фоточувствительность фотоприемников, созданных на основе выращенных структур, не уступают параметрам, опубликованным ранее для структур, выращенных методами молекулярно-лучевой эпитаксии.

Авторы благодарны А. П. Шотову и А. И. Бабушкину за возможность использовать их данные по фотопроводимости, А. Р. Гареевой и В. И. Петрову за возможность использовать данные измерений в РЭМ, Б. Р. Варданяну и Р. Р. Резванову за помощь в измерениях катодолюминесценции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] L. C. Chiu, J. S. Smith, S. Margalit, A. Yariv, A. Z. Cho. Infr. Phys. 23, 93 (1983).
- [2] B. F. Levine, C. G. Bethea, G. Hasnain, V. O. Shen, E. Pelve, S. Hsieh, R. R. Abbott. SPIE Conf., 30, 114 (1988).
- [3] B. F. Levine, C. G. Bethea, G. Hasnain, V. O. Shen, E. Pelve, R. R. Abbott, S. J. Hsieh. Appl. Phys. Lett., 56, 851 (1990).
- [4] E. Pelve, F. Beltram, C. G. Bethea, B. F. Levine, V. J. Shen, S. Hsieh, R. R. Abbott. J. Appl. Phys., 66, 5656 (1989).
- [5] C. J. Bethea, B. F. Levine, V. O. Shen, R. R. Abbott, S. J. Hsieh. IEEE Trans. Electron. Dev., 38, 1118 (1991).
- [6] C. S. Wu, C. P. Wen, R. N. Sato, HuMing, C. V. Tu, J. Zheng, L. D. Flesner, Le Fam, P. S. Nagd. IEEE Trans. Electron. Dev., 39, 234 (1992).
- [7] А. Я. Шик. ФТП, 20, 1598 (1986).
- [8] В. В. Осипов, Ф. Л. Серженко, В. Д. Шадрин. ФТП, 23, 809 (1989).
- [9] Ф. Л. Серженко, В. Д. Шадрин. ФТП, 25, 1579 (1991).
- [10] A. A. Kastalsky, T. Duffield, S. J. Allen, J. Harbison. Appl. Phys. Lett. 52, 1320 (1988).
- [11] J. Y. Anderson, L. Lundqvist, Z. Paska. Appl. Phys. Lett., 58, 2264 (1991).
- [12] B. F. Levine, C. G. Bethea, K. G. Glodovsky, G. W. Stayt, R. E. Leibenguth. Semicond. Sci. Techn., 6, 114 (1991).
- [13] А. Г. Петров, Шик А. Я. ФТП, 24, 1431 (1990).

- [14] G. Bastard. Phys. Rev. B, **24**, 4714 (1981).
- [15] C. Priester, G. Allan, M. Lannoo. Phys. Rev. B, **28**, 7194 (1983).
- [16] M. A. Herman. Semiconductor Superlattices. Berlin (1986).
- [17] M. A. Herman, D. Bimberg, J. Christen. J. Appl. Phys., **70**, R1 (1991).
- [18] Е. И. Левин, В. Л. Нгуен, Б. И. Шкловский. ЖЭТФ, **92**, 1499 (1987).
- [19] Ф. Г. Пикус, А. Л. Эфрос. ЖЭТФ, **96**, 895 (1989).
- [20] V. I. Petrov. Phys. St. Sol. (1992).
- [21] B. V. Shanabrook, J. Comas. Surf. Sci., **12**, 504 (1984).

Редактор В. В. Чалдышев
